



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2024-0048293
(43) 공개일자 2024년04월15일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

H01M 4/36 (2006.01) C01G 53/00 (2006.01)
H01M 10/052 (2010.01) H01M 4/02 (2006.01)
H01M 4/505 (2010.01) H01M 4/525 (2010.01)
H01M 4/62 (2006.01)

(52) CPC특허분류

H01M 4/366 (2022.01)
C01G 53/50 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2022-0127897

(22) 출원일자 2022년10월06일

심사청구일자 없음

(71) 출원인

현대자동차주식회사

서울특별시 서초구 현릉로 12 (양재동)

기아 주식회사

서울특별시 서초구 현릉로 12 (양재동)

인천대학교 산학협력단

인천광역시 연수구 갯벌로 27, 인천대학교 이노베이션센터(송도동)

(72) 발명자

오승민

인천광역시 연수구 원인재로 14, 111동 401호

반성호

경기도 화성시 동탄문화센터로 38, 418동 1703호

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

특허법인 신세기

전체 청구항 수 : 총 14 항

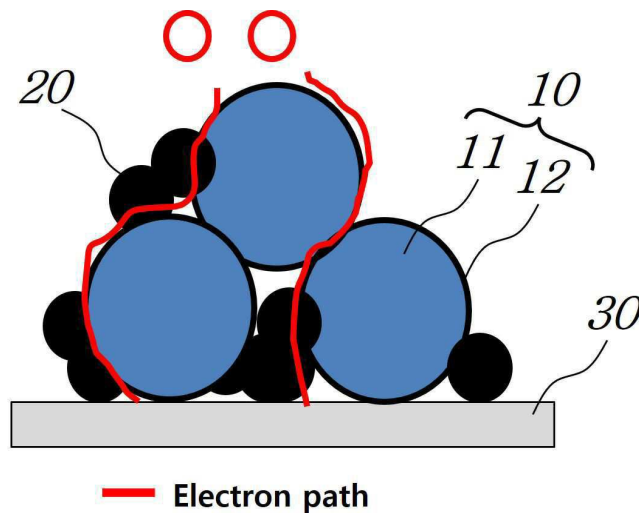
(54) 발명의 명칭 리튬 이차전지용 양극재 및 이의 제조방법

(57) 요약

본 발명은 활물질의 표면에 안정적으로 산화처리된 탄소나노튜브를 부착시켜서 전자 전도성을 높이고 표면안전성을 향상시킨 리튬 이차전지용 양극재 및 이의 제조방법에 관한 것이다.

본 발명의 일 실시형태에 따른 리튬 이차전지용 양극재는 Li-Ni-Co-Mn-M-O계(M = 전이금속)로 이루어진 양극활물질 코어와; 상기 양극활물질 코어의 표면에 상기 양극활물질 코어 100wt% 대비 표면이 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT) 1 ~ 3wt%가 코팅되는 산화탄소나노튜브 코팅층을 포함한다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류

H01M 10/052 (2013.01)

H01M 4/505 (2013.01)

H01M 4/525 (2013.01)

H01M 4/625 (2013.01)

H01M 2004/028 (2013.01)

(72) 발명자

이상훈

경기도 파주시 조리읍 능안로 37, 106동 704호

송창훈

서울특별시 성동구 금호로 173, 101동 801호

이윤성

경기도 수원시 권선구 동수원로145번길 23, 413동
1103호

김고은

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 만수길 31-5, 301호

호반즈영

인천광역시 연수구 샘말로21번길 5, 401호

문준영

서울특별시 관악구 청룡길 78, 104동 1304호

명세서

청구범위

청구항 1

Li-Ni-Co-Mn-M-O계(M = 전이금속)로 이루어진 양극활물질 코어와;

상기 양극활물질 코어의 표면에 상기 양극활물질 코어 100wt% 대비 표면이 산화처리된 탄소나노튜브(CNT) 1 ~ 3wt%가 코팅되는 산화탄소나노튜브 코팅층을 포함하는 리튬 이차전지용 양극재.

청구항 2

청구항 1에 있어서,

상기 양극활물질 코어는 $\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z\text{M}_{1-x-y-z}\text{O}_2$ 이고,

$0.3 < x < 1$, $0 < y < 0.4$, $0 < z < 0.7$ 를 만족하는 것을 특징으로 하는 리튬 이차전지용 양극재.

청구항 3

청구항 1에 있어서,

상기 산화탄소나노튜브 코팅층을 형성하는 탄소나노튜브의 길이는 300nm 이상인 것을 특징으로 하는 리튬 이차전지용 양극재.

청구항 4

청구항 1에 있어서,

상기 산화탄소나노튜브 코팅층을 형성하는 탄소나노튜브는 XPS(X-ray Photoelectron Spectroscopy) 분석시 C: 97.5 ~ 98.5%, O: 1.5 ~ 2.5%로 형성되는 것을 특징으로 하는 리튬 이차전지용 양극재.

청구항 5

Li-Ni-Co-Mn-M-O계(M = 전이금속)로 이루어진 양극활물질 코어를 준비하는 준비단계와;

탄소나노튜브(CNT)를 열처리하여 표면을 산화처리하는 산처리단계와;

상기 양극활물질 코어의 표면에 산화처리된 탄소나노튜브(CNT)를 코팅하여 산화탄소나노튜브 코팅층을 형성하는 코팅단계를 포함하는 리튬 이차전지용 양극재의 제조방법.

청구항 6

청구항 5에 있어서,

상기 준비단계에서 준비되는 양극활물질 코어는 $\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z\text{M}_{1-x-y-z}\text{O}_2$ 이고,

$0.3 < x < 1$, $0 < y < 0.4$, $0 < z < 0.7$ 를 만족하는 것을 특징으로 하는 리튬 이차전지용 양극재의 제조방법.

청구항 7

청구항 5에 있어서,

상기 산처리단계에서 열처리하는 공기(air) 분위기에서 200 ~ 500℃의 온도범위로 1 ~ 5시간동안 실시하는 것을 특징으로 하는 리튬 이차전지용 양극재의 제조방법.

청구항 8

청구항 7에 있어서,

상기 산처리단계에서 열처리하는 300 ~ 400℃의 온도범위에서 실시하는 것을 특징으로 하는 리튬 이차전지용 양극재의 제조방법.

청구항 9

청구항 5에 있어서,

상기 코팅단계는 물리적인 코팅(Physical Coating) 방식에 의해 표면이 산화처리된 탄소나노튜브(CNT)를 상기 양극활물질 코어의 표면에 부착시켜 산화탄소나노튜브 코팅층을 형성하는 것을 특징으로 하는 리튬 이차전지용 양극재의 제조방법.

청구항 10

청구항 9에 있어서,

상기 코팅단계는, 양극활물질 코어와 산화처리된 상기 탄소나노튜브를 블레이드가 없고 원통형의 로터가 중심에서 회전되는 밀링 머신에 투입하고 2000 ~ 4000rpm으로 10 ~ 20분간 상기 로터를 회전시켜 상기 양극활물질 코어의 표면에 산화처리된 탄소나노튜브를 부착시키는 것을 특징으로 하는 리튬 이차전지용 양극재의 제조방법.

청구항 11

청구항 10에 있어서,

상기 코팅단계에서 상기 양극활물질 코어의 표면에 부착되는 산화처리된 탄소나노튜브(CNT)의 양은 상기 양극활물질 코어 100wt% 대비 1 ~ 3wt%인 것을 특징으로 하는 리튬 이차전지용 양극재의 제조방법.

청구항 12

청구항 10에 있어서,

상기 코팅단계에서,

상기 양극활물질 코어의 표면에 부착된 산화처리된 탄소나노튜브의 길이는 300nm 이상인 것을 특징으로 하는 리튬 이차전지용 양극재의 제조방법.

청구항 13

청구항 5에 있어서,

상기 코팅단계는 건식으로 실시되는 것을 특징으로 하는 리튬 이차전지용 양극재의 제조방법.

청구항 14

청구항 1에 따른 양극재를 포함하는 양극;

음극 활물질을 포함하는 음극; 및

전해질;

을 포함하는 리튬 이차전지.

발명의 설명

기술 분야

- [0001] 본 발명은 리튬 이차전지용 양극재 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 활물질의 표면에 안정적으로 산화처리된 탄소나노튜브를 부착시켜서 전자 전도성을 높이고 표면안전성을 향상시킨 리튬 이차전지용 양극재 및 이의 제조방법에 관한 것이다.

배경 기술

- [0003] 이차전지는 전기 자동차나 전지 전력 저장 시스템 등의 대용량 전력 저장 전지와 휴대 전화, 캠코더, 노트북 등의 휴대 전자기기의 소형의 고 성능 에너지원으로 사용되고 있다. 휴대 전자기기의 소형화와 장시간 연속 사용을 목표로 부품의 경량화와 저 소비 전력화에 대한 연구와 더불어 소형이면서 고 용량을 실현할 수 있는 이차전지가 요구되고 있다.
- [0004] 특히, 대표적인 이차전지인 리튬 이차전지는 니켈 망간 전지나 니켈 카드뮴 전지보다 에너지 밀도가 높고 면적당 용량이 크고, 자기 방전율이 낮으며 수명이 길다. 또한, 메모리 효과가 없어서 사용의 편리성과 장수명의 특성을 갖는다.
- [0005] 리튬 이차전지는 리튬 이온의 삽입(intercalations) 및 탈리(deintercalation)가 가능한 활물질로 이루어진 양극과 음극 사이에 전해질을 충전시킨 상태에서 리튬 이온이 양극 및 음극에서 삽입/탈리 될 때의 산화와 환원 반응에 의해 전기 에너지가 생산된다.
- [0006] 이러한 리튬 이차전지는 양극재, 전해질, 분리막, 음극재 등으로 구성되며, 구성요소 간의 계면 반응을 안정하게 유지하는 것이 전지의 장수명 및 신뢰성 확보를 위해 매우 중요하다.
- [0007] 이렇게 리튬 이차전지의 성능을 향상시키기 위하여 양극재를 개선하는 연구가 꾸준히 진행되고 있다. 특히 고성능 및 고안전성의 리튬 이차전지를 개발하기 위하여 많은 연구가 진행되고 있다.
- [0008] 예를 들어 Ni-rich 양극활물질 소재가 상용화되어 양극소재로 사용되고 있다.
- [0009] 하지만, Ni-rich 양극활물질 소재는 전자 전도도가 낮고, 이온 전도도가 다른 양극활물질에 비해 상대적으로 낮다. 이는 이차전지의 싸이클 진행 시, 저항 증가에 취약하고, 고속 충전 및 방전 성능에 한계로 작용한다.
- [0010] 또한, Ni-rich 양극활물질 소재는 표면이 불안정한 한계가 있다. Ni^{3+} 상태는 화학적으로 불안정한 상태로써 전해액에 노출 시, 전기화학적 부반응이 가속화되고, 이는 표면 저항을 증가시켜, 이차전지의 수명 특성을 저해하거나 cell-swelling 현상을 야기시킨다.
- [0011] 그래서, 최근에는 고에너지를 구현할 수 있는 양극활물질 소재의 표면에 전자 전도성을 향상시키면서 표면 안전성을 향상시킬 수 있도록 다양한 방식으로 탄소 성분을 코팅하는 기술이 연구되고 있다.
- [0012] 예를 들어 양극활물질 소재의 표면에 탄소 전구체를 이용하여 탄소를 코팅하는 방법과 스퍼터링(sputtering)을 통하여 양극활물질 소재의 표면에 탄소를 증착시키는 방법이 있다.
- [0013] 탄소 전구체를 이용하여 탄소를 코팅하는 방법은 탄소를 포함한 유기물 (sucrose, glycol 등)을 이용하여 양극활물질의 표면에 코팅을 1차 진행한 이후에 고전도성 탄화를 위하여, 후열 탄화 공정을 진행한다. 이때 탄화 온도가 높을 수록 고결정성 탄소가 얻어져, 전자 전도성이 향상된다. 그런데, 400℃ 이상의 온도에서 탄소와 산소

의 화학반응에 의해 CO_2 가 생성되는 기체 생성 반응(Carbon thermal reduction)이 진행되는 문제가 있어, 400°C 이상 탄화 공정 진행 시, 비활성 Ar 분위기의 제어가 필수적이다. 하지만, 옥사이드(oxide) 계열 소재는 고온 Ar 열처리에 취약하여 고온 Ar 탄화 공정 진행이 불가능한 한계가 있다.

[0014] 따라서, 탄소 전구체를 이용하여 탄소를 코팅하는 방법은 소재의 결정성 안정성이 뛰어난 LiFePO_4 등과 같은 polyanion 계열 음극 소재나 $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$, NaCrO_2 등과 같은 고안정성 산화물 소재에 매우 제한적으로 적용 중이고, 안정성이 낮은 Ni-rich 소재에는 적용이 불가능하다.

[0015] 스퍼터링(sputtering)을 통하여 양극활물질 소재의 표면에 탄소를 증착시키는 방법은 산화물 탄화 열처리 공정을 하지 않아도 되는 장점이 있지만, 고결정성 탄소를 코팅할 수 없어 전도성 향상이 제한적이고, 탄소 스퍼터링(Carbon sputtering) 공정 설비의 제한으로 대량 생산이 어려운 한계가 있다.

[0016] 한편, 고전도성 탄소 소재 도입을 위하여 전극 형성시 도전제로 탄소나노튜브(CNT)를 단순히 혼합하여 사용하는 기술이 제안되었다.

[0017] 하지만, 양극활물질과 탄소나노튜브(CNT)를 단순히 혼합하는 경우에 양극활물질의 표면에 탄소나노튜브(CNT)가 고르게 분산되는데 한계가 있고, 원하는 전도성을 확보하기 위해서는 탄소나노튜브(CNT)의 혼합량이 많아지는 문제도 있다.

[0019] 상기의 배경기술로서 설명된 내용은 본 발명에 대한 배경을 이해하기 위한 것일 뿐, 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 이미 알려진 종래기술에 해당함을 인정하는 것으로 받아들여져서는 안 될 것이다.

선행기술문헌

특허문헌

[0021] (특허문헌 0001) 공개특허공보 제10-2019-0083701호(2019.07.15)

발명의 내용

해결하려는 과제

[0022] 본 발명은 고에너지를 구현할 수 있는 Ni-rich 양극활물질 소재의 결정 구조를 유지하면서, 그 표면에 안정적으로 표면이 산화처리된 탄소나노튜브를 부착시켜서 전자 전도성을 높이고 표면안정성을 향상시킨 리튬 이차전지용 양극재 및 이의 제조방법을 제공한다.

[0024] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 본 발명의 기재로부터 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확히 이해될 수 있는 것으로 보아야 할 것이다.

과제의 해결 수단

[0026] 본 발명의 일 실시형태에 따른 리튬 이차전지용 양극재는 Li-Ni-Co-Mn-M-O계(M = 전이금속)로 이루어진 양극활물질 코어와; 상기 양극활물질 코어의 표면에 상기 양극활물질 코어 100wt% 대비 표면이 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT) 1 ~ 3wt%가 코팅되는 산화탄소나노튜브 코팅층을 포함한다.

[0027] 상기 양극활물질 코어는 $\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z\text{M}_{1-x-y-z}\text{O}_2$ 이고, $0.3 < x < 1$, $0 < y < 0.4$, $0 < z < 0.7$ 를 만족하는 것을 특징으로 한다.

[0028] 상기 산화탄소나노튜브 코팅층을 형성하는 탄소나노튜브의 길이는 300nm 이상인 것을 특징으로 한다.

[0029] 상기 산화탄소나노튜브 코팅층을 형성하는 탄소나노튜브는 XPS(X-ray Photoelectron Spectroscopy) 분석시 C:

97.5 ~ 98.5%, 0: 1.5 ~ 2.5%로 형성되는 것을 특징으로 한다.

- [0031] 한편, 본 발명의 일 실시형태에 따른 리튬 이차전지용 양극재의 제조방법은 Li-Ni-Co-Mn-M-O계(M = 전이금속)로 이루어진 양극활물질 코어를 준비하는 준비단계와; 탄소나노튜브(CNT)를 열처리하여 표면을 산화처리하는 산처리단계와; 상기 양극활물질 코어의 표면에 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)를 코팅하여 산화탄소나노튜브 코팅층을 형성하는 코팅단계를 포함한다.
- [0032] 상기 준비단계에서 준비되는 양극활물질 코어는 $\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z\text{M}_{1-x-y-z}\text{O}_2$ 이고, $0.3 < x < 1$, $0 < y < 0.4$, $0 < z < 0.7$ 를 만족하는 것을 특징으로 한다.
- [0033] 상기 산처리단계에서 열처리는 공기(air) 분위기에서 200 ~ 500℃의 온도범위로 1 ~ 5시간동안 실시하는 것을 특징으로 한다.
- [0034] 상기 산처리단계에서 열처리는 300 ~ 400℃의 온도범위에서 실시하는 것을 특징으로 한다.
- [0035] 상기 코팅단계는 물리적인 코팅(Physical Coating) 방식에 의해 표면이 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)를 상기 양극활물질 코어의 표면에 부착시켜 산화탄소나노튜브 코팅층을 형성하는 것을 특징으로 한다.
- [0036] 상기 코팅단계는, 양극활물질 코어와 산화처리된 상기 탄소나노튜브를 블레이드가 없고 원통형의 로터가 중심에서 회전되는 밀링 머신에 투입하고 2000 ~ 4000rpm으로 10 ~ 20분간 상기 로터를 회전시켜 상기 양극활물질 코어의 표면에 산화처리된 탄소나노튜브를 부착시키는 것을 특징으로 한다.
- [0037] 상기 코팅단계에서 상기 양극활물질 코어의 표면에 부착되는 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)의 양은 상기 양극활물질 코어 100wt% 대비 1 ~ 3wt%인 것을 특징으로 한다.
- [0038] 상기 코팅단계에서, 상기 양극활물질 코어의 표면에 부착된 산화처리된 탄소나노튜브의 길이는 300nm 이상인 것을 특징으로 한다.
- [0039] 상기 코팅단계는 건식으로 실시되는 것을 특징으로 한다.
- [0041] 한편, 본 발명의 일 실시형태에 따른 리튬 이차전지는
- [0042] Li-Ni-Co-Mn-M-O계(M = 전이금속)로 이루어진 양극활물질 코어와; 상기 양극활물질 코어의 표면에 상기 양극활물질 코어 100wt% 대비 표면이 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT) 1 ~ 3wt%가 코팅되는 산화탄소나노튜브 코팅층으로 이루어지는 양극재를 포함하는 양극; 음극 활물질을 포함하는 음극; 및 전해질을 포함한다.

발명의 효과

- [0044] 본 발명의 실시예에 따르면, Ni-rich 양극활물질 코어의 결정 구조를 유지하면서, 양극활물질 코어의 표면에 산화처리된 탄소나노튜브를 안정적으로 부착시킴으로써, 고에너지를 유지하면서, 전자 전도성을 높일 수 있고, 표면 안전성의 향상을 기대할 수 있다.
- [0045] 특히, 물리적 밀링을 이용하여 양극활물질 코어의 표면에 산화처리된 탄소나노튜브(CNT)를 안정적으로 부착시킴으로써, 양극활물질 코어에 영향을 주지 않으면서, 대량 생산도 가능하여 통한 코팅으로 소재에 영향을 주지 않으며, 대량 생산도 기대할 수 있는 효과가 있다.
- [0046] 이에 따라 순수 전기차 모델을 구축할 수 있고, 이에 따라 기존에 설계된 차량 구조에 구동장치를 없는 방식인 하이브리드 및 파생형 전기차 대비 배터리 중심인 순수 전기차의 제작 비용을 절감할 수 있는 효과를 기대할 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0048] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 리튬 이차전지용 양극재를 포함하는 양극을 보여주는 모식도이고,
- 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 리튬 이차전지용 양극재의 제조방법 중 탄소나노튜브를 양극활물질 코어에

코팅하는 방식을 보여주는 모식도이며,

도 3a 및 도 3b는 순수한 탄소나노튜브(Pure-CNT)와 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)의 XPS를 분석하여 C와 O의 비율을 비교한 결과를 보여주는 도면이고,

도 4는 양극활물질 코어 및 양극활물질 코어에 코팅되는 순수한 탄소나노튜브(CNT)와 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)를 보여주는 SEM 이미지이며,

도 5는 양극활물질 코어 및 양극활물질 코어에 코팅되는 순수한 탄소나노튜브(CNT)와 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)의 XPS를 분석한 결과를 보여주는 도면이고,

도 6은 산처리단계에서의 열처리 온도에 따른 TGA 분석 결과를 보여주는 도면이며,

도 7은 대조군, 비교예 및 실시예에 따른 이차전지의 출력특성을 보여주는 도면이고,

도 8은 대조군, 비교예 및 실시예에 따른 이차전지의 초기 효율 성능을 보여주는 도면이며,

도 9는 대조군, 비교예 및 실시예에 따른 이차전지의 수명 특성 성능을 보여주는 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0049] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
- [0050] 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다.
- [0051] 본 명세서에 개시된 실시 예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시 예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
- [0052] 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
- [0053] 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
- [0054] 본 명세서에서, "포함한다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
- [0056] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 리튬 이차전지용 양극재를 포함하는 양극을 보여주는 모식도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 리튬 이차전지용 양극재의 제조방법 중 탄소나노튜브를 양극활물질 코어에 코팅하는 방식을 보여주는 모식도이다.
- [0057] 도 1에 도시된 바와 같이 본 발명의 일 실시예에 따른 리튬 이차전지용 양극재(10)는 리튬 이차전지에 적용되는 양극을 형성하는 물질로서, 양극 활물질 코어(11)와, 양극 활물질 코어(11)의 표면에 형성된 산화탄소나노튜브 코팅층(20)으로 이루어진다. 그리고, 리튬 이차전지는 상기 양극재(10)를 포함하는 양극; 음극 활물질을 포함하는 음극; 및 전해질을 포함한다. 도 1에서 도면 부호 20은 도전재이고, 도면 부호 30은 양극을 형성하는 전극기재(30)이다.
- [0058] 양극활물질 코어는 리튬 이온의 가역적인 삽입(intercalations) 및 탈리(deintercalation)가 가능하면서 Ni-rich 상태인 Li-Ni-Co-Mn-M-O계의 물질로 이루어질 수 있다. 여기서 M은 전이금속이다.
- [0059] 바람직하게는 양극활물질 코어는 $\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z\text{M}_{1-x-y-z}\text{O}_2$ 이고, 이때 $0.3 < x < 1$, $0 < y < 0.4$, $0 < z < 0.7$ 를 만족하는 것이 바람직하다.

- [0060] 한편, 산화탄소나노튜브 코팅층은 양극활물질 코어의 표면에 표면이 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)가 물리적으로 부착되어 형성된다. 이때 산화탄소나노튜브 코팅층을 형성하는 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)는 양극재의 전자 전도성을 향상시키기 위하여 양극활물질 코어의 표면에 물리적으로 부착되는 소재이다.
- [0061] 산화탄소나노튜브 코팅층을 균일한 두께로 형성하면서 양극활물질 코어의 표면에 균일하게 부착될 수 있도록 양극활물질 코어의 표면에 부착된 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)의 길이가 300nm 이상이 되도록 하는 것이 바람직하다.
- [0062] 한편, 산화탄소나노튜브 코팅층을 형성하는 표면이 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT) 중 산소(O)가 차지하는 비율은 순수한 탄소나노튜브(CNT)보다 4배 정도 높은 것이 바람직하다. 예를 들어 산화탄소나노튜브 코팅층을 형성하는 표면이 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)는 XPS(X-ray Photoelectron Spectroscopy) 분석시 C: 97.5 ~ 98.5%, O: 1.5 ~ 2.5%로 형성되는 것이 바람직하다.
- [0063] 이에 따라 산화탄소나노튜브 코팅층을 형성하는 표면이 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)의 양은 상기 양극활물질 코어 100wt% 대비 1 ~ 3wt%인 것이 바람직하다.
- [0065] 상기와 같이 형성되는 양극재의 제조방법에 대하여 설명한다.
- [0066] 본 발명의 일 실시예에 따른 리튬 이차전지용 양극재의 제조방법은 크게 양극활물질 코어를 준비하는 준비단계와; 탄소나노튜브(CNT)를 열처리하여 표면을 산화처리하는 산처리단계와; 양극활물질 코어의 표면에 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)를 코팅하여 산화탄소나노튜브 코팅층을 형성하는 코팅단계를 포함하여 이루어진다.
- [0067] 준비단계는 양극활물질 코어를 준비하는 단계로서, Li-Ni-Co-Mn-M-O계(M = 전이금속)의 Ni-rich 한 상태의 소재를 이용하여 양극활물질 코어를 준비한다.
- [0068] 부연하자면, 양극활물질 코어는 $\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z\text{M}_{1-x-y-z}\text{O}_2$ 이고, 이때 $0.3 < x < 1$, $0 < y < 0.4$, $0 < z < 0.7$ 를 만족하는 것이 바람직하다.
- [0069] 그리고, 산처리단계는 순수한 탄소나노튜브(CNT)를 고온 분위기에서 열처리하여 탄소나노튜브(CNT)의 표면을 산화처리 시킨다. 그래서, 표면이 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)가 양극재의 표면에서 발생하는 부반응을 억제할 수 있고, 이에 따라 이차전지의 초기 효율 및 용량을 증대시킬 수 있다.
- [0070] 산처리단계에서 실시되는 열처리는 공기(air) 분위기에서 200 ~ 500℃의 온도범위로 1 ~ 5시간동안 실시하는 것이 바람직하다. 더욱 바람직하게는 열처리 온도범위를 300 ~ 400℃에서 실시하는 것이 좋다.
- [0071] 만약, 열처리 온도가 제시된 범위보다 낮을 경우에는 탄소나노튜브(CNT)의 표면이 충분히 산화처리되지 않는 문제가 발생하고, 열처리 온도가 제시된 범위보다 높을 경우에는 탄소(C)의 결합이 발생하고 이에 따라 탄소나노튜브에 의한 전자 전도성이 저하되는 문제가 발생할 수 있다.
- [0072] 마찬가지로 열처리 시간도 제시된 범위보다 적을 경우에는 탄소나노튜브(CNT)의 표면이 충분히 산화처리되지 않는 문제가 발생하고, 열처리 시간이 제시된 범위보다 많을 경우에는 탄소(C)의 결합이 발생하고 이에 따라 탄소나노튜브에 의한 전자 전도성이 저하되는 문제가 발생할 수 있다.
- [0073] 그리고, 코팅단계는 도 2에 도시된 바와 같이 준비된 양극활물질 코어의 표면에 건식 방식의 물리적인 코팅(Physical Coating) 방식에 의해 표면이 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)를 양극활물질 코어의 표면에 부착시켜서 산화탄소나노튜브 코팅층을 형성한다.
- [0074] 예를 들어, 블레이드가 없고 원통형의 로터가 중심에서 회전되는 밀링 머신을 준비한 다음, 밀링 머신에 양극활물질 코어와 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)를 투입하고 2000 ~ 4000rpm으로 10 ~ 20분간 로터를 회전시켜 양극활물질 코어의 표면에 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)를 부착시킨다.
- [0075] 이때 밀링 머신의 회전속도가 2000rpm 보다 느릴 경우에는 양극활물질 코어의 표면에 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)가 충분히 부착되지 않고, 회전속도가 4000rpm 보다 빠를 경우에는 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)가 끊어지면서 양극활물질 코어의 표면에 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)가 균일하게 부착되지 않고, 짧아진 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)에 의해 전자 전도성이 저하되는 문제가 발생할 수 있다.
- [0076] 또한, 밀링 머신에 의한 코팅 시간이 10분 보다 적을 경우에는 양극활물질 코어의 표면에 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)가 충분히 부착되지 않고, 코팅 시간이 20분 보다 많을 경우에는 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)가

짧게 끊어지는 문제가 발생할 수 있다.

- [0077] 그래서, 최초 밀링 머신에 투입된 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)의 길이 대비 밀링 머신의 코팅 완료된 시점에서 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)의 길이가 30 ~ 70%를 유지하도록 한다.
- [0078] 그리고, 코팅단계에서 양극활물질 코어의 표면에 부착되는 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)의 양은 양극활물질 코어 100wt% 대비 1 ~ 3wt%인 것이 바람직하다.
- [0079] 그래서, 양극활물질 코어에 원하는 두께로 균일하게 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)가 부착되도록 양극활물질 코어는 입경이 5 μ m 이상인 것을 사용하고, 밀링 머신에 의한 코팅이 완료된 시점에서 양극활물질 코어의 표면에 산화탄소나노튜브 코팅층을 형성하는 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)의 길이는 300nm 이상이 유지 되도록 한다.
- [0081] 다음으로, 대조군, 비교예 및 실시예를 통하여 본 발명을 설명한다.
- [0082] 먼저, 본 발명의 실시예에 따라 제조되는 양극재 및 리튬 이차전지의 상태 및 성능을 알아보기 위하여 다양한 실시예, 비교예 및 대조군을 준비하였다.
- [0083] <실시예 1>
- [0084] 양극활물질 코어로 $\text{LiNi}_{0.89}\text{Co}_{0.04}\text{Mn}_{0.07}\text{O}_2$ 를 준비하였고, 순수한 탄소나노튜브로 다중벽 탄소나노튜브(MWCNT)를 준비하였다.
- [0085] 그리고, 다중벽 탄소나노튜브(MWCNT)의 표면을 산화처리하기 위하여 준비된 다중벽 탄소나노튜브(MWCNT), 즉 순수한 탄소나노튜브(pure-CNT)를 퍼니스(furnace)에 넣고 공기(Air)를 200cc/min유량으로 흘린 다음 분당 5 $^{\circ}\text{C}$ 씩 승온하여 300 $^{\circ}\text{C}$ 에서 2시간 동안 열처리를 실시하였다.
- [0086] 그리고, 양극활물질 코어 100wt%에 대하여 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT) 2wt%를 밀링 머신에 투입하고, 3000rpm의 회전속도로 10분 동안 코팅을 진행하였고, 결과물인 양극재를 도전재 및 바인더와 95 : 2 : 3의 비율로 NMP용매에 혼합하여 슬러리를 제작하였다. 그리고 슬러리를 알루미늄 기체에 코팅 후 건조, 압연 후 진공오븐에 건조 후 R2032타입 코인셀로 제작하였다.
- [0087] <실시예 2>
- [0088] 순수한 탄소나노튜브(Pure-CNT)의 열처리시 열처리 온도를 200 $^{\circ}\text{C}$ 에서 실시한 것을 제외한 다른 조건을 실시예 1과 동일한 방식으로 코인셀을 제작하였다.
- [0089] <실시예 3>
- [0090] 순수한 탄소나노튜브(pure-CNT)의 열처리시 열처리 온도를 400 $^{\circ}\text{C}$ 에서 실시한 것을 제외한 다른 조건을 실시예 1과 동일한 방식으로 코인셀을 제작하였다.
- [0091] <실시예 4>
- [0092] 순수한 탄소나노튜브(pure-CNT)의 열처리시 열처리 온도를 500 $^{\circ}\text{C}$ 에서 실시한 것을 제외한 다른 조건을 실시예 1과 동일한 방식으로 코인셀을 제작하였다.
- [0093] <비교예>
- [0094] 그리고, 밀링 머신에 양극활물질 코어와 산화처리되지 않은 순수한 탄소나노튜브(Pure-CNT)를 투입한 것을 제외한 다른 조건을 실시예 1과 동일한 방식으로 코인셀을 제작하였다.
- [0095] <대조군; Bare>
- [0096] 실시예 1과 동일한 양극활물질 코어, 도전재 및 바인더를 95: 2: 3의 비율로 NMP용매에 혼합하여 슬러리를 제작하였다. 그리고 슬러리를 알루미늄 기체에 코팅 후 건조, 압연 후 진공오븐에 건조 후 R2032타입 코인셀로 제작하였다.
- [0098] 먼저, 비교예에 적용되는 산화처리되지 않은 순수한 탄소나노튜브(Pure-CNT)와 실시예 1에 적용되는 산화처리된

탄소나노튜브(OCNT)에 대하여 XPS 분석을 실시하여 C와 O의 비율을 도 3a 및 도 3b에 나타내었다.

[0099] 도 3a는 순수한 탄소나노튜브(Pure-CNT)와 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)의 XPS를 분석하여 C의 비율을 비교한 결과를 보여주는 도면이고, 도 3b는 순수한 탄소나노튜브(Pure-CNT)와 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)의 XPS를 분석하여 O의 비율을 비교한 결과를 보여주는 도면이다.

[0100] 도 3a 및 도 3b에서 알 수 있듯이, 순수한 탄소나노튜브(Pure-CNT) 대비 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)는 표면에서 탄소(C)의 비율은 줄어들고, 산소(O)의 비율은 증가한 것을 확인할 수 있다. 특히, 산소비율이 순수한 탄소나노튜브(Pure-CNT)에서는 0.054%였지만, 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)에서는 0.202%로 약 4배 정도 증가한 것을 확인할 수 있었다.

[0101] 이는 탄소나노튜브의 표면을 산화처리하는 하는 열처리에 의해 탄소나노튜브의 표면에 산화 작용기가 증가한 것을 유추할 수 있다.

[0103] 다음으로, 대조군, 비교예 및 실시예 1에 적용되는 양극재의 SEM 이미지를 촬영하였고, 그 결과를 도 4에 나타내었다.

[0104] 도 4에서 알 수 있듯이, 비교예와 마찬가지로 실시예 1에서도 양극활물질 코어의 표면에 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)가 균일하게 부착된 것을 확인할 수 있었다.

[0106] 다음으로, 대조군, 비교예 및 실시예 1에 적용되는 양극재의 표면을 XPS 분석하였고, 그 결과를 표 1에 나타내었다.

표 1

[0107]

구분	C	Li	Ni	Co	Mn	O
대조군	20.74	23.58	6.12	0.8	0	48.76
비교예	60.32	8.6	4.62	0.56	0	25.91
실시예1	62.61	5.84	3.33	0.6	0	27.62

[0108] 표 1에서 알 수 있듯이, 비교예 및 실시예1은 모두 대조군에 비하여 표면의 탄소(C) 비율이 증가한 것을 확인할 수 있었다. 특히, 실시예 1은 비교예에 비하여 표면의 탄소(C) 비율이 더 증가하였다. 이에 따라 실시예 1에 따른 양극재를 이차전지에 적용하는 경우에 전자 전도성을 향상시킬 수 있다는 것을 예측할 수 있다.

[0110] 다음으로, 대조군, 비교예 및 실시예 1에 적용되는 양극재의 표면을 XPS 분석하였고, 그 결과를 도 5에 나타내었다.

[0111] 도 5에서 알 수 있듯이, 실시예 1에서는 대조군인 Ni-rich 양극활물질 코어에서 발생하는 Ni의 스펙트럼이 감소한 것을 확인할 수 있었다.

[0112] 또한, 비교예 및 실시예 1에서 양극활물질 코어의 표면에 순수한 탄소나노튜브(Pure-CNT) 및 산화처리된 탄소나노튜브(OCNT)가 균일하게 코팅된 것을 확인할 수 있었다.

[0114] 다음으로, 산처리단계에서 열처리 온도의 변화에 따라 탄소나노튜브의 산화처리에 미치는 영향을 알아보기 위하여 열처리 온도를 변경하면서 탄소나노튜브의 표면을 산화처리하였고, 그 결과를 도 6에 나타내었다.

[0115] 도 6에서 알 수 있듯이, 열처리 온도가 증가할수록 탄소나노튜브의 표면에 서 산화처리되는 양이 증가하는 것을 확인할 수 있었다.

[0116] 다만, 열처리 온도가 500℃, 정확하게는 515℃를 넘어서면서 탄소나노튜브가 분해되는 것을 확인할 수 있었다.

[0117] 또한, 열처리 온도가 200℃보다 낮은 구간에는 탄소나노튜브의 산화처리된 양이 너무 적은 것을 확인할 수 있었다.

[0118] 이에 따라 산처리단계에서의 열처리는 200 ~ 500℃의 온도 범위에서 실시하는 것이 바람직하다는 것을 확인할 수 있었다.

[0120] 다음으로, 대조군, 비교예 및 실시예들에 따라 제조된 이차전지의 출력특성을 측정하였고, 그 결과를 표 2 및 도 7에 나타내었다.

표 2

[0121]

1 st / each condition	0.1 C	0.5 C	1 C	3 C	5 C	10 C
대조군	217.5	198.9	188.4	142.7	66.72	7
비교예	218.5	200.4	187.5	148.5	115.8	2.8
실시예2(200℃)	218.5	199.9	187.9	153.8	99.5	10.2
실시예1(300℃)	221.7	202.7	188.8	163.1	132.8	45.2
실시예3(400℃)	217.8	198.7	187.7	154.2	120.8	17.7
실시예4(500℃)	218.2	199.9	190.6	156.8	103.7	10.5

[0122] 표 2 및 도 7에서 알 수 있듯이, 실시예 1 내지 실시예 4는 측정된 다양한 전류밀도에서 전반적으로 대조군 및 비교예에 비하여 출력특성이 향상된 것을 확인할 수 있었다.

[0123] 특히, 실시예 1 및 실시예 3는 측정된 모든 전류밀도에서 대조군 및 비교예에 비하여 출력특성이 향상된 것을 확인할 수 있었다.

[0124] 따라서, 산처리단계에서의 열처리는 200 ~ 500℃의 온도 범위에서 실시하는 것이 바람직하다는 것을 확인할 수 있었다.

[0126] 다음으로, 대조군, 비교예 및 실시예 1에 따라 제조된 이차전지의 초기 효율 성능을 측정하였고, 그 결과를 도 8에 나타내었다.

[0127] 이때 도 8은 25℃ 환경에서의 초기 효율을 측정한 결과이다.

[0128] 도 8에서 알 수 있듯이, 실시예 1은 대조군 및 비교예에 비하여 초기 효율 성능이 향상된 것을 확인할 수 있었다.

[0130] 다음으로, 대조군, 비교예 및 실시예 1에 따라 제조된 이차전지의 수명 특성 성능을 측정하였고, 그 결과를 도 9에 나타내었다.

[0131] 도 9에서 알 수 있듯이, 실시예 1은 대조군에 비하여 초기 효율 성능이 상당히 향상된 것을 확인할 수 있었다.

[0132] 또한, 실시예 1은 비교예와 비교하여도 초기 효율 성능이 유사하거나 향상된 것을 확인할 수 있었다.

[0134] 본 발명을 첨부 도면과 전술된 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였으나, 본 발명은 그에 한정되지 않으며, 후술되는 특허청구범위에 의해 한정된다. 따라서, 본 기술분야의 통상의 지식을 가진 자라면 후술되는 특허청구범위의 기술적 사상에서 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 변형 및 수정할 수 있다.

부호의 설명

[0136]

10: 양극재

11: 양극활물질 코어

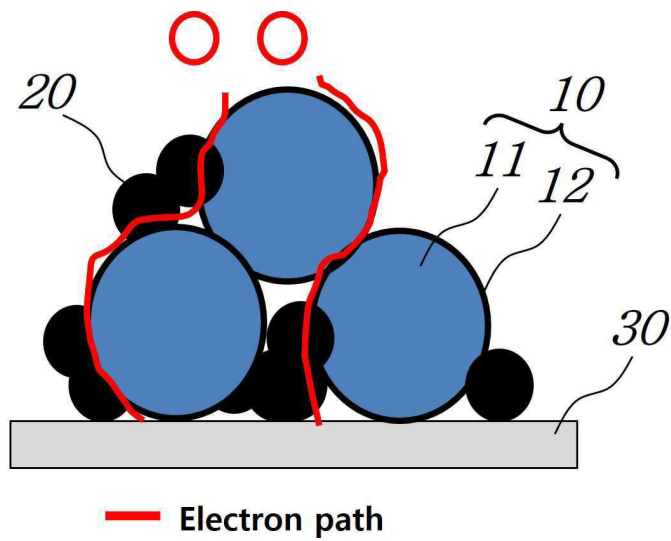
12: 탄소나노튜브 코팅층

20: 도전재

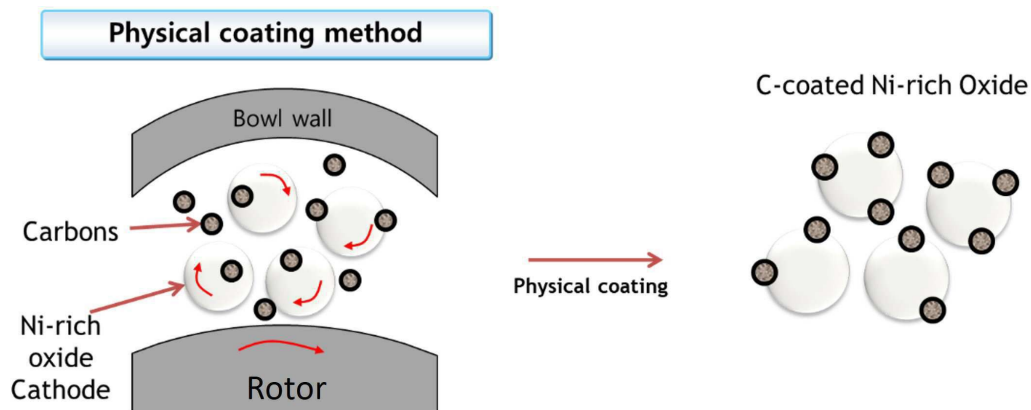
30: 전극기재

도면

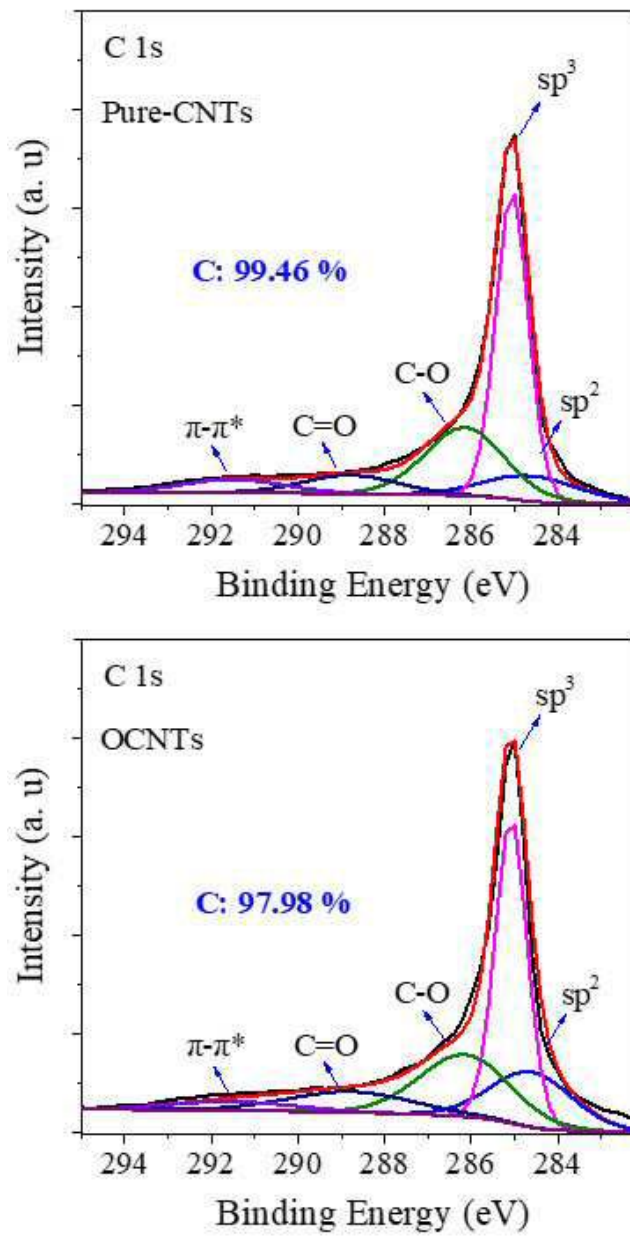
도면1



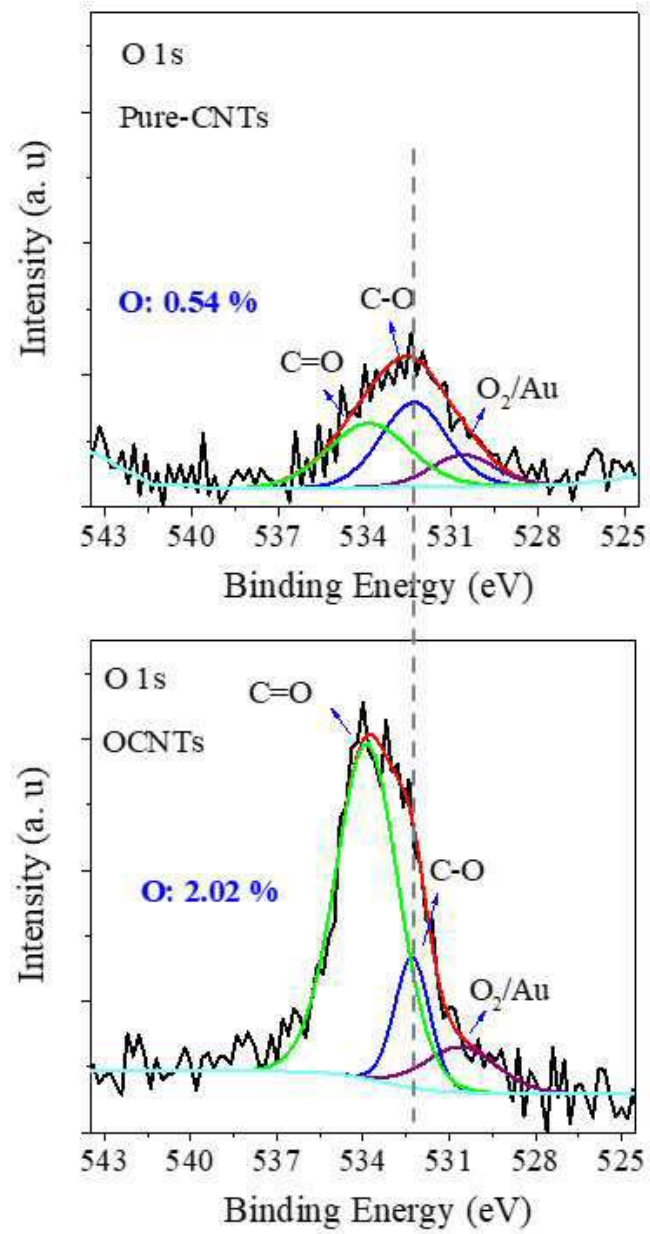
도면2



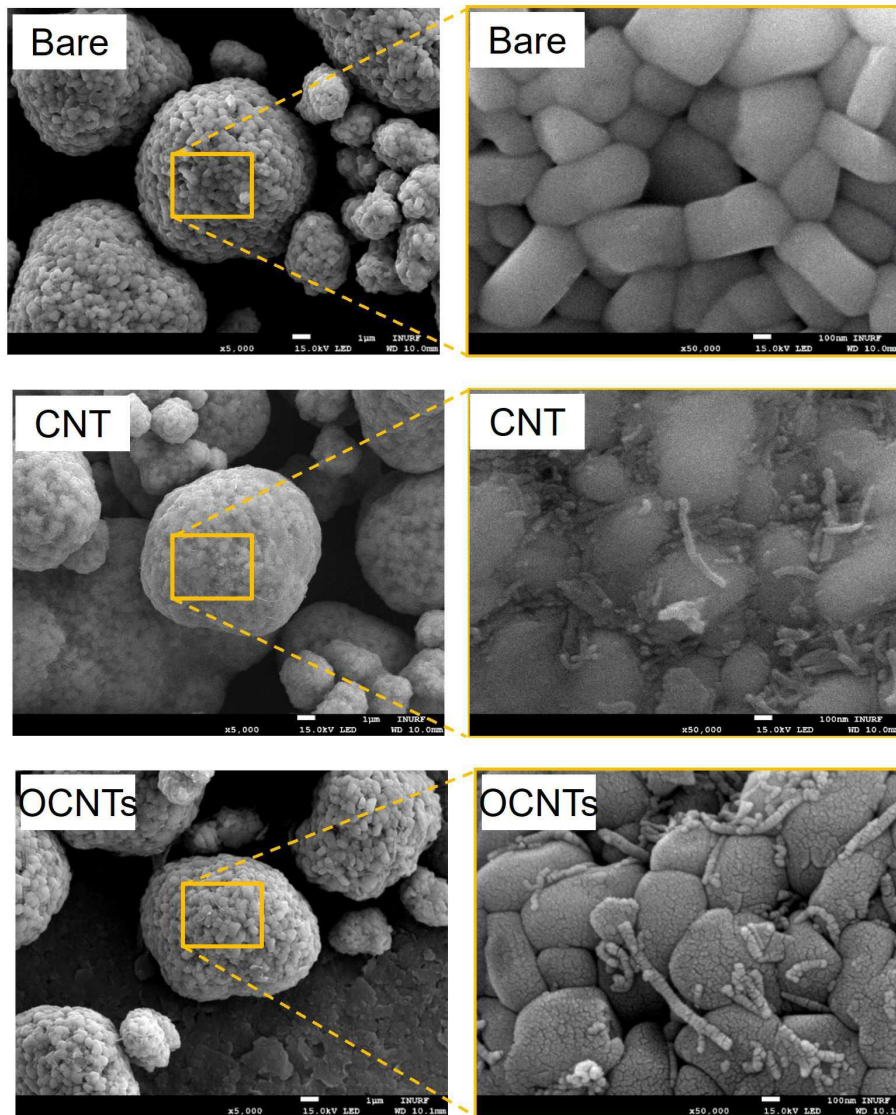
도면3a



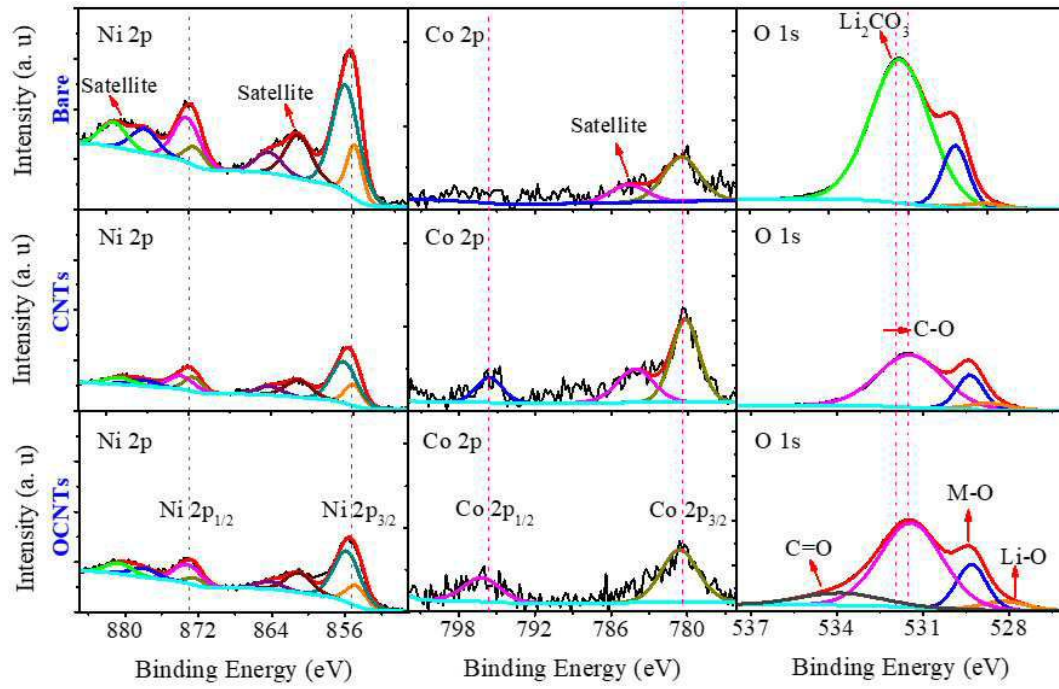
도면3b



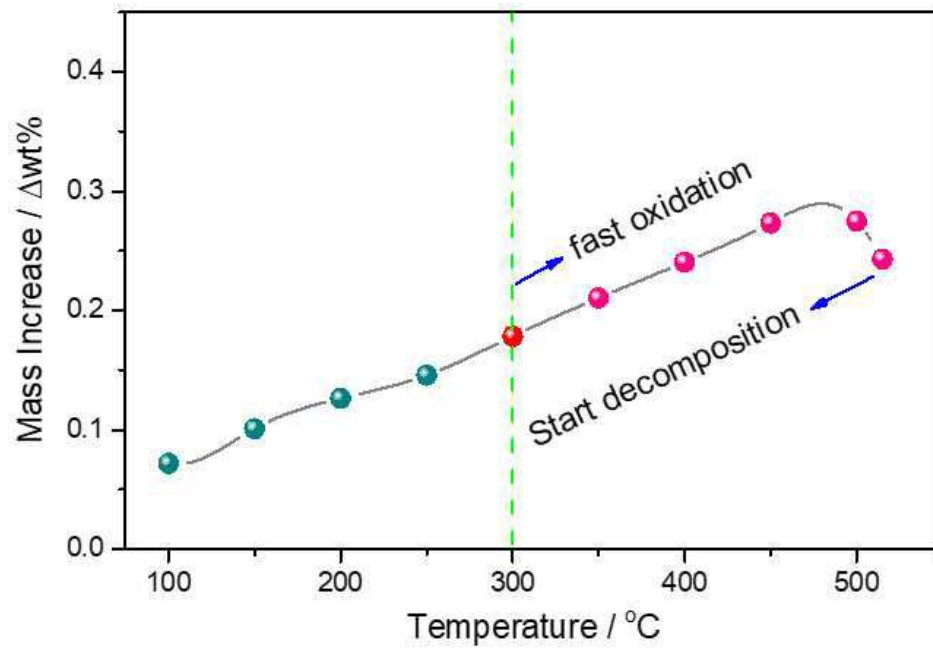
도면4



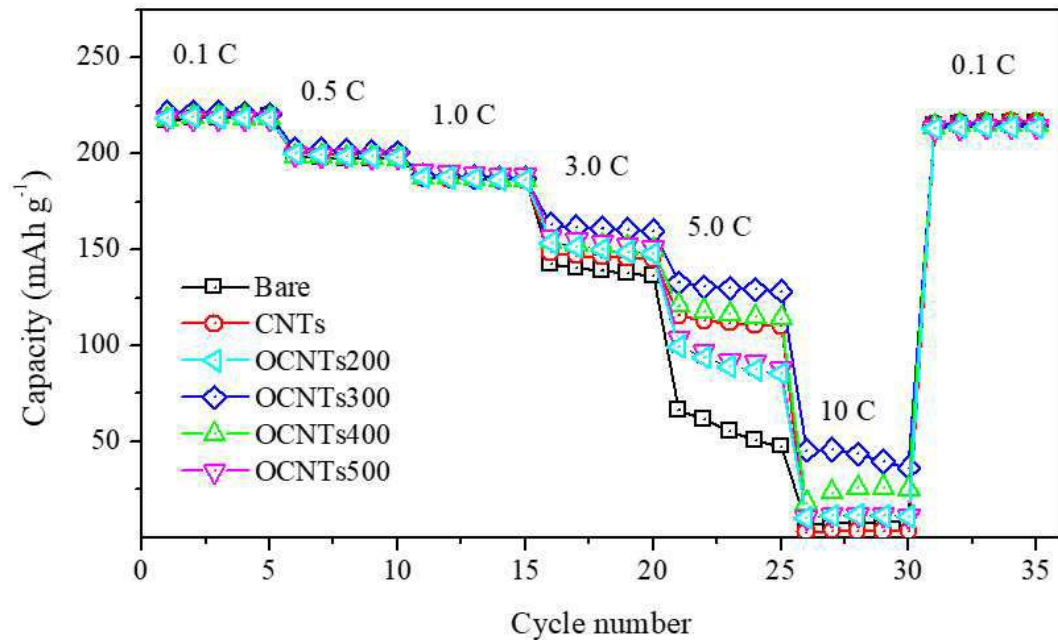
도면5



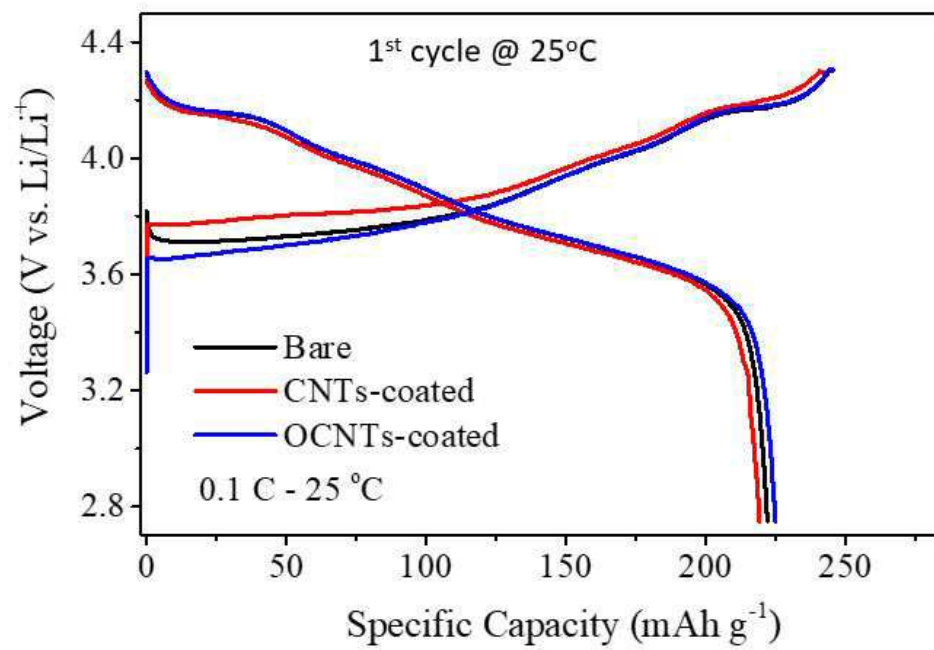
도면6



도면7



도면8



도면9

